

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-321302

(43)Date of publication of application : 05.11.2002

---

(51)Int.Cl. B32B 9/00  
B32B 27/00  
G02B 1/11  
G02B 5/08  
G02B 5/28  
G02B 5/30

---

(21)Application number : 2001-129426

(71)Applicant : NIPPON ZEON CO LTD

(22)Date of filing : 26.04.2001

(72)Inventor : HATAKE KOTARO

---

(54) POLYMER RESIN LAMINATED MATERIAL CONTAINING ALICYCLIC STRUCTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laminated material which is superior in bond strength, durability and an optical performance of a multilayer thin film.

SOLUTION: A layer (A) of which main component is SiO<sub>x</sub> ( $1 \leq x \leq 2$ ) is formed on a molding composed of a polymer resin containing an alicyclic structure, and then a layer (B) of which main component is tantalum pentoxide is further formed on its surface.

---

---

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 07.03.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(11)特許出願公開番号

特開2002-321302

(P2002-321302A)

(43)公開日 平成14年11月5日(2002.11.5)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード(参考)
B 3 2 B	9/00	B 3 2 B	A 2 H 0 4 2
	27/00		A 2 H 0 4 8
G 0 2 B	1/11	G 0 2 B	D 2 H 0 4 9
	5/08		2 K 0 0 9
	5/28		4 F 1 0 0

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 10 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願2001-129426(P2001-129426)	(71)出願人	000229117 日本ゼオン株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
(22)出願日	平成13年4月26日(2001.4.26)	(72)発明者	畠 好太郎 栃木県佐野市小中町234番地1 株式会社 オプテス内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 脂環式構造含有重合体樹脂積層体

(57) 【要約】

【課題】多層薄膜の密着強度、耐久性、及び光学性能に優れた積層体を提供すること。

【解決手段】脂環式構造含有重合体樹脂からなる成形体上に、 $\text{SiO}_x$  ( $1 \leq x \leq 2$ ) を主成分とする層 (A) を形成し、さらにその上に五酸化タンタルを主成分とする層 (B) を形成する。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 脂環式構造含有重合体樹脂からなる成形体上に、 $\text{SiO}_x$  ( $1 \leq x \leq 2$ ) を主成分とする層

(A) を有し、さらにその上に五酸化タンタルを主成分とする層 (B) を有することを特徴とする積層体。

【請求項2】 層 (B) 中における五酸化タンタルの含有量が50重量%以上である請求項1記載の積層体。

【請求項3】 層 (B) の上に、さらに1層以上の無機化合物層及び／又は有機化合物層を積層してなる請求項1又は2記載の積層体。

【請求項4】 光学部品である請求項1乃至3記載の積層体。

【請求項5】 金属反射膜を有する脂環式構造含有重合体樹脂成形体の該金属反射膜上に、 $\text{SiO}_x$  ( $1 \leq x \leq 2$ ) を主成分とする層 (A) を有し、さらにその上に五酸化タンタルを主成分とする層 (B) を有することを特徴とする積層体。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、脂環式構造含有重合体樹脂からなる積層体に関し、さらに詳しくは光学部品として好適な積層体に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 樹脂成形体は、金属反射膜、反射防止膜、及び波長選択透過膜などの各種光学薄膜を表面に形成して光学部品として利用されている。光学部品には、光学薄膜を何層にも積層して多層膜を形成し、高度な機能を付与したものがある。このような光学部品では、樹脂成形体と多層膜との密着強度が十分でないと、温度変化のある環境下においては多層膜と樹脂成形体の熱膨張率の違いによって多層膜にマイクロクラックが発生したり、多層膜が樹脂成形体から剥離したりなどする。一般に、プラスチック材料と多層膜との密着強度を高めるために、シリコン系樹脂をアンダーコート処理したり、成形体上の第一層（基材と接する層）の材料として  $\text{SiO}$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{CeO}_2$  等を使用することが提案されている。

【0003】 一方、熱可塑性ノルボルネン系樹脂などの脂環式構造含有重合体樹脂は、透明性、耐熱性、低吸水性などに優れ、光学部品の材料として注目されている。しかし、熱可塑性ノルボルネン系樹脂成形体においては、シリコン系樹脂によるアンダーコート処理をしてもアンダーコートが剥離しやすく、又、非球面レンズ等の、寸法精度を求められる光学部品ではアンダーコートにより形状が変化してしまうので適用ができなかった。また、 $\text{SiO}$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{CeO}_2$  を第一層目として真空蒸着させ、その上に多層膜を形成しても、密着強度が不十分であったり、温度変化のある環境下で使用すると積層した光学膜にマイクロクラックが生じたりした。また、 $\text{Ta}_2\text{O}_5$  を主成分とする層を熱可塑性ノルボルネン

ン系樹脂基材上に直接形成して下地層とし、その上に多層膜を形成することにより、該下地層と多層膜との密着性に優れた光学部品が得られることが特開平6-312467号公報に報告されている。しかし、熱可塑性ノルボルネン系樹脂成形品表面に  $\text{Ta}_2\text{O}_5$  の下地層を形成すると、光学性能が低下し、全ての光学部品には適用できなかった。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、多層膜の密着性、耐久性、及び光学特性に優れた積層体を提供することにある。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、熱可塑性ノルボルネン系樹脂成形体の表面第一層目に酸化ケイ素を主成分とする層を形成し、次いでその直上に五酸化タンタルを主成分とする層を積層することによって、さらにその上に積層した無機化合物薄膜等からなる多層膜の密着強度及び耐久性が顕著に向上し、光学性能にも優れていることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0006】 かくして本発明によれば、脂環式構造含有重合体樹脂からなる成形体上に、 $\text{SiO}_x$  ( $1 \leq x \leq 2$ ) を主成分とする層 (A) を有し、さらにその上に五酸化タンタルを主成分とする層 (B) を有することを特徴とする積層体が提供される。また、本発明によれば、層 (B) 中における五酸化タンタルの含有量が50重量%以上である上記の積層体が、層 (B) の上に、さらに1層以上の無機化合物層及び／又は有機化合物層を積層してなる上記の積層体が、光学部品である上記の積層体がそれぞれ提供される。さらに本第二発明によれば、金属反射膜を有する脂環式構造含有重合体樹脂成形体の該金属反射膜上に、 $\text{SiO}_x$  ( $1 \leq x \leq 2$ ) を主成分とする層 (A) を有し、さらにその上に五酸化タンタルを主成分とする層 (B) を有することを特徴とする積層体が提供される。

## 【0007】

【発明の実施の形態】 本発明の積層体は、脂環式構造含有重合体樹脂からなる基材上に、 $\text{SiO}_x$  ( $1 \leq x \leq 2$ ) を含む層 (A) を有し、さらにその上に五酸化タンタルを主成分とする層 (B) を有することを特徴とするものである。

【0008】 上記脂環式構造含有重合体樹脂は、重合体の繰返し単位中に脂環式構造を含有するものであり、主鎖及び／または側鎖のいずれに脂環式構造を有していてもよい。脂環式構造としては、シクロアルカン構造、シクロアルケン構造などが挙げられるが、透明性の観点からシクロアルカン構造が好ましい。脂環式構造を構成する炭素原子数は、格別な制限はないが、通常4～30個、好ましくは5～20個、より好ましくは5～15個の範囲であると、透明性に優れる。脂環式構造含有重合

体中の脂環式構造を有する繰り返し単位の割合は、使用目的に応じて適宜選択されればよいが、通常50重量%以上、好ましくは70重量%以上、より好ましくは90重量%以上である。脂環式構造含有重合体中の脂環式構造を有する繰り返し単位の割合が過度に少ないと透明性が低下し、好ましくない。なお、脂環式構造含有重合体中の脂環式構造を有する繰り返し単位以外の残部は、格別な限定はなく、使用目的に応じて適宜選択される。

【0009】こうした脂環式構造を含有する重合体樹脂の具体例としては、(1)ノルボルネン系重合体、

(2)単環の環状オレフィン系重合体、(3)環状共役ジエン系重合体、(4)ビニル脂環式炭化水素重合体、及びこれらの水素添加物などが挙げられる。これらの中でも、透明性の観点から、ノルボルネン系重合体水素添加物、ビニル脂環式炭化水素重合体又はその水素化物などが好ましく、ノルボルネン系重合体水素添加物がより好ましい。

【0010】(1)ノルボルネン系重合体

本発明に使用されるノルボルネン系重合体は、例えば、特開平3-14882号公報や、特開平3-122137号公報などに開示されている公知の重合体であり、具体的には、ノルボルネン系モノマーの開環重合体、ノルボルネン系モノマーと開環共重合可能なその他のモノマーとの開環共重合体、及びそれらの水素添加物、ノルボルネン系モノマーの付加重合体、ノルボルネン系モノマーと共重合可能なその他のモノマーとの付加型共重合体などが挙げられる。これらの中でも、透明性の観点から、ノルボルネン系モノマーの開環重合体水素添加物が最も好ましい。

【0011】ノルボルネン系モノマーとしては、ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン(慣用名:ノルボルネン)、5-メチル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5, 5-ジメチル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-エチル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-ブチル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-ヘキシル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-オクチル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-オクタデシル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-エチリデン-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-メチリデン-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-ビニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-プロペニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、

【0012】5-メトキシカルボニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-シアノ-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-メチル-5-メトキシカルボニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-メトキシカルボニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-エトキシカル

ボニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-メチル-5-エトキシカルボニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-5-エニル-2-メチルプロピオネイト、ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-5-エニル-2-メチルオクタネイト、ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン-5, 6-ジカルボン酸無水物、5-ヒドロキシメチル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5, 6-ジ(ヒドロキシメチル)-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシ-1-プロピル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5, 6-ジカルボキシ-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5, 6-ジカルボン酸イミド、5-シクロペンチル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-シクロヘキシル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-シクロヘキセニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、5-フェニル-ビシクロ〔2, 2, 1〕-ヘプト-2-エン、

【0013】トリシクロ〔4, 3, 1<sup>2, 5</sup>, 0<sup>1, 6</sup>〕-デカ-3, 7-ジエン(慣用名ジシクロペンタジエン)、トリシクロ〔4, 3, 1<sup>2, 5</sup>, 0<sup>1, 6</sup>〕-デカ-3-エン、トリシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 0<sup>1, 6</sup>〕-ウンデカ-3, 7-ジエン、トリシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 0<sup>1, 6</sup>〕-ウンデカ-3, 8-ジエン、トリシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 0<sup>1, 6</sup>〕-ウンデカ-3-エン、テトラシクロ〔7, 4, 1<sup>10, 13</sup>, 0<sup>1, 9</sup>, 0<sup>2, 7</sup>〕-トリデカ-2, 4, 6-11-テトラエン(1, 4-メタノ-1, 4, 4a, 9a-テトラヒドロフルオレンともいう)、テトラシクロ〔8, 4, 1<sup>11, 14</sup>, 0<sup>1, 10</sup>, 0<sup>3, 8</sup>〕-テトラデカ-3, 5, 7, 12-11-テトラエン(1, 4-メタノ-1, 4, 4a, 5, 10, 10a-ヘキサヒドロアントラセンともいう)、

【0014】テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 1<sup>7, 10</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン(テトラシクロドデセンともいう)、8-メチル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 1<sup>7, 10</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-メチル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 1<sup>7, 10</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-エチル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 1<sup>7, 10</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-メチリデン-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 1<sup>7, 10</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-エチリデン-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 1<sup>7, 10</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-ビニル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 1<sup>7, 10</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-プロペニル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2, 5</sup>, 1<sup>7, 10</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、

【0015】8-メトキシカルボニル-テトラシクロ

〔4, 4, 1<sup>2</sup>, 5, 1<sup>7</sup>, 1<sup>0</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-メチル-8-メトキシカルボニル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2</sup>, 5, 1<sup>7</sup>, 1<sup>0</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-ヒドロキシメチル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2</sup>, 5, 1<sup>7</sup>, 1<sup>0</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-カルボキシ-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2</sup>, 5, 1<sup>7</sup>, 1<sup>0</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-シクロペンチル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2</sup>, 5, 1<sup>7</sup>, 1<sup>0</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-シクロヘキシル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2</sup>, 5, 1<sup>7</sup>, 1<sup>0</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、8-シクロヘキセニル-テトラシクロ〔4, 4, 1<sup>2</sup>, 5, 1<sup>7</sup>, 1<sup>0</sup>, 0〕-ドデカ-3-エン、ペンタシクロ〔6, 5, 1<sup>1</sup>, 8, 1<sup>3</sup>, 6, 0<sup>2</sup>, 7, 0<sup>9</sup>, 1<sup>3</sup>〕-ペンタデカ-3, 10-ジエン、ペンタシクロ〔7, 4, 1<sup>3</sup>, 6, 1<sup>10</sup>, 1<sup>3</sup>, 0<sup>1</sup>, 9, 0<sup>2</sup>, 7〕-ペンタデカ-4, 11-ジエンなどが挙げられる。これらのノルボルネン系モノマーは、それぞれ単独であるいは2種以上組み合わせ用いられる。

【0016】これらノルボルネン系モノマーの開環重合体、またはノルボルネン系モノマーと開環共重合可能なその他のモノマーとの開環共重合体は、モノマー成分を、開環重合触媒の存在下で重合して得ることができる。たとえば、開環重合触媒としては、例えば、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、白金などの金属のハロゲン化物、硝酸塩またはアセチルアセトン化合物と、還元剤とからなる触媒系、あるいは、チタン、バナジウム、ジルコニウム、タングステン、モリブデンなどの金属のハロゲン化物またはアセチルアセトン化合物と、有機アルミニウム化合物とからなる触媒系を用いられる。重合反応は溶媒中または無溶媒で、通常、-50℃~100℃の重合温度、0~50 kg/cm<sup>2</sup>の重合圧力で行われる。ノルボルネン系モノマーと開環共重合可能なその他のモノマーとしては、例えば、特開昭64-66216号公報に開示されているシクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテンなどの単環の環状オレフィン系単量体などを挙げることができる。

【0017】ノルボルネン系モノマーの開環重合体水素添加物は、通常、上記開環重合体の重合溶液に、水素添加触媒を添加し、水素添加することにより得ることができる。水素添加触媒としては、特に限定されないが、通常、不均一系触媒や均一系触媒が用いられる。

【0018】ノルボルネン系モノマー、またはノルボルネン系モノマーと共重合可能なその他のモノマーとの付加(共)重合体は、例えば、モノマー成分を、溶媒中または無溶媒で、チタン、ジルコニウム又はバナジウム化合物と、有機アルミニウム化合物とからなる触媒系の存在下で、通常、-50℃~100℃の重合温度、0~5

0 kg/cm<sup>2</sup>の重合圧力で(共)重合させる方法により得ることができる。

【0019】共重合可能なその他のモノマーとしては、例えば、エチレン、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、3-メチル-1-ブテン、3-メチル-1-ペンテン、3-エチル-1-ペンテン、4-メチル-1-ペンテン、4-メチル-1-ヘキセン、4, 4-ジメチル-1-ヘキセン、4, 4-ジメチル-1-ペンテン、4-エチル-1-ヘキセン、3-エチル-1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エイコセンなどの炭素数2~20の $\alpha$ -オレフィン；シクロブテン、シクロペンテン、シクロヘキセン、3, 4-ジメチルシクロペンテン、3-メチルシクロヘキセン、2-(2-メチルブチル)-1-シクロヘキセン、シクロオクテン、3a, 5, 6, 7a-テトラヒドロ-4, 7-メタノ-1H-インデンなどのシクロオレフィン；1, 4-ヘキサジエン、4-メチル-1, 4-ヘキサジエン、5-メチル-1, 4-ヘキサジエン、1, 7-オクタジエンなどの非共役ジエン；などが用いられる。これらの中でも、 $\alpha$ -オレフィン、特にエチレンが好ましい。

【0020】これらの共重合可能なその他のモノマーは、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせ使用することができる。ノルボルネン系モノマーと共重合可能なその他のモノマーとを付加共重合する場合は、付加共重合体中のノルボルネン系モノマー由来の繰り返し単位と共重合可能なその他のモノマー由来の繰り返し単位との割合が、重量比で通常30:70~99:1、好ましくは50:50~97:3、より好ましくは70:30~95:5の範囲となるように適宜選択される。

【0021】(2) 単環の環状オレフィン系重合体  
単環の環状オレフィン系重合体としては、例えば、特開昭64-66216号公報に開示されているシクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテンなどの単環の環状オレフィン系単量体の付加重合体を用いることができる。

【0022】(3) 環状共役ジエン系重合体  
環状共役ジエン系重合体としては、例えば、特開平6-136057号公報や特開平7-258318号公報に開示されているシクロペンタジエン、シクロヘキサジエンなどの環状共役ジエン系単量体を1, 2-または1, 4-付加重合した重合体及びその水素添加物などを用いることができる。

【0023】本発明で使用されるノルボルネン系重合体、単環の環状オレフィン系重合体、または環状共役ジエン系重合体の分子量は、使用目的に応じて適宜選択されるが、シクロヘキサン溶液(重合体樹脂が溶解しない場合はトルエン溶液)のゲル・パーミエーション・クロ

マトグラフ法で測定したポリイソブレンまたはポリスチレン換算の重量平均分子量で、通常5,000~500,000、好ましくは8,000~200,000、より好ましくは10,000~100,000の範囲であるときに、成形体の機械的強度、及び成形加工性とが高度にバランスされて好適である。

【0024】(4) ビニル脂環式炭化水素重合体  
 ビニル脂環式炭化水素重合体としては、例えば、特開昭51-59989号公報に開示されているビニルシクロヘキセン、ビニルシクロヘキサンなどのビニル脂環式炭化水素系単量体の重合体及びその水素添加物、特開昭63-43910号公報、特開昭64-1706号公報などに開示されているスチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンなどのビニル芳香族系単量体の重合体の芳香環部分の水素添加物などを用いることができる。この場合、ビニル脂環式炭化水素重合体やビニル芳香族系単量体と、これらの単量体と共重合可能な他の単量体とのランダム共重合体、ブロック共重合体などの共重合体及びその水素添加物であってもよい。ブロック共重合体としては、ジブロック、トリブロック、またはそれ以上のマルチブロックや傾斜ブロック共重合体など、特に制限はない。

【0025】本発明で使用するビニル脂環式炭化水素重合体の分子量は、使用目的に応じて適宜選択されるが、シクロヘキサン溶液（重合体樹脂が溶解しない場合はトルエン溶液）のゲル・パーミエーション・クロマトグラフ法で測定したポリイソブレンまたはポリスチレン換算の重量平均分子量で、通常10,000~300,000、好ましくは15,000~250,000、より好ましくは20,000~200,000の範囲であるときに、成形体の機械的強度、及び成形加工性とが高度にバランスされて好適である。

【0026】本発明で使用する脂環式構造含有重合体樹脂のガラス転移温度（ $T_g$ ）は、使用目的に応じて適宜選択されればよいが、通常80℃以上、好ましくは100℃~250℃、より好ましくは120℃~200℃の範囲である。この範囲において、耐熱性と成形加工性とが高度にバランスされ好適である。

【0027】本発明においては、上記脂環式構造含有重合体樹脂に必要に応じて、酸化防止剤、紫外線吸収剤、耐候安定剤、耐光安定剤、及び熱安定剤などの安定剤；有機フィラーや無機フィラーなどの充填剤；染料や顔料などの着色剤；近赤外線吸収剤、可塑剤、滑剤、帯電防止剤、難燃剤、樹脂や軟質重合体などの添加剤を配合することができる。これらの添加剤は、単独であるいは2種以上を組み合わせ用いることができ、その添加量は本発明の目的を損ねない範囲で適宜選択される。

【0028】本発明においては、上記脂環式構造含有重合体樹脂を各種形状に成形し、得られた成形体の少なくとも1面に、 $SiO_x$ （ $1 \leq x \leq 2$ ）を主成分とする層（A）を形成し、次いでその上に五酸化タンタルを主成

分とする層（B）を形成する。成形体は、板状、レンズ形状、ディスク状、フィルム又はシート状、プリズム状などの、光学部品等として好適な各種形状に成形して使用することができる。成形方法としては、射出成形法、押出成形法、プレス成形法などの加熱熔融成形法、及びキャスト成形法などの溶液を用いた成形法のいずれを用いても成形することができる。

【0029】層（A）は、 $SiO_x$ （ $1 \leq x \leq 2$ ）を主成分とするものであり、具体的には、 $SiO_2$ を主成分とするもの、 $SiO$ を主成分とするもの、 $SiO_x$ （ $1 < x < 2$ ）を主成分とするものなどが挙げられ、中でも層（A）が $SiO_x$ （ $1 < x < 2$ ）を主成分とする場合には、 $SiO_2$ を主成分とするものに比較して密着性がより向上し、反射防止膜においては $SiO$ を主成分とするものよりも反射特性が向上して好ましい。層の形成には、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、イオンビームアシステッド法等が用いられ、一般に真空蒸着法が用いられる。

【0030】真空蒸着法の場合には、加熱源として抵抗加熱又は電子銃を使用し、蒸着材料には $SiO_2$ の顆粒またはタブレットを使用する。蒸着時にはチャンバー内に酸素ガスを導入してもよい。 $SiO$ 及び $SiO_x$ を成膜する場合は、加熱源として抵抗加熱又は電子銃を使用し、蒸着材料には $SiO$ を使用する。蒸着時にはチャンバー内に酸素を $8 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-3}$  Torr程度まで導入しながら $Si$ の酸化度（ $x$ ）を調整して反応性蒸着を行う。

【0031】スパッタリングの場合には、一般的なマグネトロンスパッタ装置が使用でき電源はDC電源又はRF電源のいずれも使用することができる。ターゲットには $SiO_2$ 又は $Si$ （シリコン）が使用でき、 $Si$ を使用する場合には、 $Ar$ （アルゴン）ガスの他に $O_2$ （酸素）ガスをチャンバー内に導入する。酸素ガスの導入量によって $Si$ の酸化度を調整し、 $SiO_x$ の $x$ の範囲を1~2に制御することができる。層（A）の厚さは、通常10~500nm、好ましくは30~300nm、より好ましくは50~200nmである。層（A）が薄すぎると、多層膜の密着性が低下し、厚すぎると多層膜の光学特性が低下する。

【0032】層（B）は、五酸化タンタルを主成分とするものであり、好ましくは $Ta_2O_5$ を50重量%以上、より好ましくは70重量%以上、最も好ましくは90重量%以上含有する。 $Ta_2O_5$ の含有量が少ないと多層膜の密着性及び耐久性が低下する。光学部品の種類によっては、 $Ta_2O_5$ を主成分とする層は透明である必要があり、そのために、 $Ta_2O_5$ 以外の成分の含有量は少ないことが好ましい。 $Ta_2O_5$ 以外の成分としては、 $ZrO_2$ 、 $CeO_2$ 、 $Y_2O_3$ 、 $TiO_2$ 、 $Ti_3O_5$ 、 $SiO$ 、 $Nb_2O_5$ 等が好ましい。

【0033】層の形成には、真空蒸着法、イオンプレー

ティング法、スパッタリング法、イオンビームアシステッド法等が用いられ、一般に真空蒸着法が用いられる。真空蒸着法においては、 $Ta_2O_5$ を含有する蒸発源を電子銃や抵抗加熱等で蒸発させて基材表面に蒸着させる。蒸着の条件は特に限定されず、一般の真空蒸着法に用いられる条件でよい。ただし、 $Ta_2O_5$ のみを蒸発源として電子銃や抵抗加熱等で蒸発させた場合には、蒸発した $Ta_2O_5$ 中に酸素原子が不足したものが生じる場合があり、蒸着により形成された層が着色して光を吸収することがある。したがって、蒸発時にチャンパー内に酸素を導入して $2 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-3}$  Torr程度の圧力で蒸着させることにより、着色を低減させることができる。

【0034】蒸発源として、 $ZrO_2$ 含量が3~50重量%、より好ましくは10~40重量%、特に好ましくは20~35重量%である、 $Ta_2O_5$ と $ZrO_2$ の混合物を用いると、蒸着膜が着色することがなく透明な膜が安定して得られる。なお、この場合、 $ZrO_2$ は $Ta_2O_5$ より蒸発しにくいので蒸発源中の $ZrO_2$ 含有量より大幅に少ない含有量で蒸着膜中に存在する。したがって $Ta_2O_5$ と $ZrO_2$ の混合物を用いても $Ta_2O_5$ 含有量が、通常は90重量%以上、好ましくは95重量%以上のものを容易に得ることができる。

【0035】層(B)の厚さは、通常5~500nm、好ましくは10~300nm、より好ましくは15~200nmである。層(B)が薄すぎると多層膜の密着性が低下し、厚すぎると光学特性の調整が困難となる。

【0036】層(A)、層(B)が順次形成された本発明の積層体は、五酸化タンタル層の上に、1層以上の無機化合物層及び/又は有機化合物層をさらに積層してなる多層膜を有していてもよい。本発明の積層体は、上記多層膜をさらに有する場合にも、層(A)及び層(B)を含めた多層膜の密着強度、耐久性、及び光学性能に優れたことを特徴とする。

【0037】無機化合物としては、金属酸化物、無機酸化物、金属硫化物、及び金属弗化物などが挙げられる。金属酸化物の具体例としては、酸化アルミニウム、酸化ビスマス、酸化セリウム、酸化クロム、酸化ユーロピウム、酸化鉄、酸化ルテニウム、酸化インジウム、酸化ランタン、酸化モリブデン、酸化マグネシウム、酸化ネオジム、酸化鉛、酸化プラセオジム、酸化サマリウム、酸化アンチモン、酸化スカンプジウム、酸化スズ、酸化チタン、一酸化チタン、三酸化二チタン、五酸化タンタル、酸化タングステン、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛などが挙げられる。その他の酸化物(無機酸化物)の具体例としては、酸化ケイ素、一酸化ケイ素などが挙げられる。金属硫化物の具体例としては、硫化亜鉛などが挙げられる。金属弗化物の具体例としては、弗化アルミニウム、弗化バリウム、弗化セリウム、弗化カルシウム、弗化ランタン、弗化リチウム、弗

化マグネシウム、クリオライト、チオライト、弗化ネオジム、弗化ナトリウム、弗化鉛、弗化サマリウム、弗化ストロンチウムなどが挙げられる。

【0038】上記無機化合物の層は、屈折率の異なるものを、通常2種類以上交互に積層して使用するのが光学性能を向上させる観点から好ましい。無機化合物層を形成する方法としては、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの方法を用いることができるが、上記無機化合物を分散させた溶液を塗布した後に溶媒を除去する方法や、上記無機化合物からなるフィルム(単層フィルムでも積層フィルムでも可)を接着する方法などの方法を用いてもよい。

【0039】有機化合物層としては、アクリルモノマーの硬化層(紫外線硬化樹脂層など)、及びシリコン硬化層などの、光学部品等の保護層等として用いられる層を積層することができる。

【0040】上記無機化合物層又は有機化合物層の1層の厚さは、5~500nm、好ましくは10~300nmである。

【0041】本第二発明は、金属反射膜を有する脂環構造含有重合体樹脂成形体の該金属反射膜上に $SiO_x$ ( $1 \leq x \leq 2$ )を主成分とする層(A)を有し、さらにその上に五酸化タンタルを主成分とする層(B)を有することを特徴とする積層体である。この積層体によって、多層膜の密着性、耐久性、及び光学特性に優れた光学部品を提供し得る第二の発明である。該積層体も、さらに1層以上の無機化合物層及び/又は有機化合物層を積層すれば高度な機能が付与された光学部品として好適に使用できる。尚、脂環構造含有重合体樹脂成形体表面に金属反射膜を形成する際には、その下地層として酸化ケイ素を主成分とする層を形成してもよい。反射膜に用いる金属としては、アルミニウム、ニッケル、クロム、銀、金、白金、鉛などが挙げられる。本第二発明の積層体中の各層の厚み、形成方法等は、第一発明と同様である。

【0042】以上のようにして、層(A)及び層(B)の上にさらに1層以上の無機化合物層及び/又は有機化合物層を積層して得られる多層膜は、反射防止膜、波長選択透過膜、偏光膜、反射膜、導電膜などとして機能させることができるので、得られた積層体は、レンズ、プリズム、光ディスク、光学フィルター、ビームスプリッター、ミラー、導光板、液晶基板、偏光フィルム、位相差フィルム、反射防止フィルム(ARフィルム)などの光学部品として使用することができる。また、本発明の積層体は、光学部品に限らず、ラップフィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、ガスバリアーフィルムなどの包装フィルム；プレススルーパッケージシート、プリスターパッケージシートなどのパッケージ用のシート；導電フィルム、絶縁フィルム、フレキシブル回路基板などの電気・電子部品用フィルムなどにも使用で

きる。

#### 【0043】

【実施例】以下、本発明について、製造例、実施例、及び比較例を挙げて、より具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらの例に限定されるものではない。これらの例において、〔部〕は、特に断りのない限り、重量基準である。また、各種物性の測定法は、次の通りである。

【0044】(1)  $T_g$  は、示差走査熱量計 (DSC 法) により測定した。

(2) 分子量は、特に記載しない限り、シクロヘキサンを溶媒とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) で測定されるポリイソブレン換算値として測定した。

【0045】(3) 光学薄膜の密着性は初期密着強度及び耐久試験後の密着強度を基盤目剥離試験を用い、以下の方法で評価した。成形体 (以降基材ということがある) に光学多層薄膜を蒸着したもの、及びそれを下記条件により所定の時間耐久試験にかけたものを、常温で1時間以上放置して試験片とした。試験片の中央1か所に、カッターナイフを用いて、1mm間隔で100マスの基盤目状の切り傷をつけた。切り傷をつけるときのカッターナイフの刃先は常に新しいものを用い、塗面に対して35〜45度の範囲で一定の角度を保つようにした。切り傷は、塗膜を貫通して試験片の素地に届くように、切り傷1本につき約0.5秒間かけて等速で引いた。基盤目の上に接着部分の長さが約50mmになるようにセロハン粘着テープ (JIS Z 1522に規定するセロハン粘着テープで、粘着力2.94N/10mm以上のもの) を貼り付け、消しゴム (JIS S6050に規定するもの) で擦ってテープを塗膜に完全に付着させた。テープを付着させてから1〜2分後に、テープの一方の端を持って、塗面に直角に保ち、瞬間的に引きはがした。

(評価法) : 切り傷によりできた正方形100マス中、剥がれた正方形の数を評価した。剥がれが少ない (剥がれない) ほど密着性が良好と判断した。

【0046】(4) 光学多層薄膜の耐久性は、以下の3種の信頼性試験を行った後に密着強度を評価した。

① 高温試験 : 80℃、湿度50%、500時間

② 高温高湿度試験 : 温度60℃、湿度90%、500時間

③ 低温試験 : -30℃、湿度10%、500時間

【0047】(5) 光学性能は以下の方法により評価した。日立製作所製分光光度計U4000を用い、積層体の光線透過率を一定の入射角度にて測定した。同時に多層薄膜の反射率を一定の入射角度で測定した。波長350〜750nmの波長範囲において上記測定を実施した。

【0048】〔製造例1〕窒素雰囲気下、脱水したシクロヘキサン500部に、1-ヘキセン0.82部、ジブ

チルエーテル0.15部、トリイソブチルアルミニウム0.30部を室温で反応器に入れ混合した後、45℃に保ちながら、8-エチルテトラシクロ [4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>] -ドデカ-3-エン (以下、ETDと略す) 30部、トリシクロ [4.3.0.1<sup>2,5</sup>] デカ-3,7-ジエン (ジシクロペンタジエン、以下、DCPという) 170部および六塩化タングステン0.7%トルエン溶液40部を2時間かけて連続的に添加し重合した。重合溶液にブチルグリシジルエー

テル1.06部とイソプロピルアルコール0.52部を加えて重合触媒を不活性化し重合反応を停止させた。

【0049】次いで、得られた開環重合体を含有する反応溶液100部に対して、シクロヘキサン270部を加え、さらに水素化触媒としてニッケル-アルミナ触媒 (日揮化学社製) 5部を加え、水素により50kgf/cm<sup>2</sup>に加圧して攪拌しながら温度200℃まで加温した後、4時間反応させ、ETD/DCP開環重合体水素添加物を20%含有する反応溶液を得た。重合体中の各ノルボルネン類の共重合比率を、重合後の溶液中の残留ノルボルネン類組成 (ガスクロマトグラフィー法による) から計算したところ、ETD/DCP=15/85でほぼ仕込組成に等しかった。このETD/DCP開環重合体水素添加物の、重量平均分子量 (Mw) は31,000、水素添加率は99.9%、 $T_g$ は100℃であった。

【0050】(基材の成形) 製造例1で得られた開環重合体水素添加物100部に、老化防止剤 (吉富製薬社製トミノックスTT) 0.5部と、軟質重合体 (旭化成社製タフテックH1052) 0.02部を添加し、2軸混練機 (東芝機械社製TEM-35B、スクリュー径37mm、L/D=32、スクリュー回転数250rpm、樹脂温度230℃、フィードレート10kg/時間) で混練して押し出し、ペレット化した。

【0051】上記ペレットを、80℃、4時間で加熱予備乾燥を行った後、射出成形装置 (ファナック株式会社製の製品番号:  $\alpha$ -100B) を用いて、射出成形により、厚さ1mm、2インチの板を成形した。成形条件は、金型温度70℃、シリンダー温度270℃とした。

【0052】〔実施例1〕製造例1で得られた基材の表面に、真空蒸着法により5層多層構造の光反射防止層を形成した。膜構成は以下の通りである。

第1層 : 酸化ケイ素 ( $SiO_2$ ) 層 (層厚 (nd) = 0.5 $\lambda_0$  :  $\lambda_0$  = 530nm)

第2層 : 五酸化タンタル ( $Ta_2O_5$ ) と酸化ジルコニウム ( $ZrO_2$ ) の混合物層 ( $Ta_2O_5$  含有量98重量%以上 : nd = 0.053 $\lambda_0$  : 以降混合物層と略記する)

第3層 :  $SiO_2$  層 (nd = 0.077 $\lambda_0$ )

第4層 : 混合物層 (nd = 0.445 $\lambda_0$ )

第5層 :  $SiO_2$  層 (nd = 0.223 $\lambda_0$ ) (基材側



から第1, 2, 3, 4, 5層の順序)

尚、各層の蒸着条件は以下の通りであった。

第1, 3, 5層:  $5 \times 10^{-5}$  torr、5 オングストローム/sec

第2, 4層:  $0.8 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-4}$  torr、

0.5 ~ 2 オングストローム/sec

\*

\*蒸着温度はいずれも約40℃であった。

【0053】以上、得られた光反射防止層を有する積層体の、該光反射防止層の密着性、耐久性、光学性能をそれぞれ評価した。結果を表1に記載する。

【0054】

【表1】

	膜密着 初期	耐久試験後密着			透過率		反射率	
		高温	高温 高湿	低温	400nm	700nm	400nm	700nm
実施例1	0/100	0/100	1/100	0/100	98.9%	99.15%	1.1%	0.85%
実施例2	0/100	0/100	0/100	0/100	98.8%	8.9%	1.2%	1.1%
実施例3	0/100	0/100	1/100	0/100	95%	10%	2.5%	90%
実施例4	0/100	0/100	1/100	0/100	97%	16%	3.0%	84%
実施例5	0/100	0/100	1/100	0/100	50%	50%	50%	50%
実施例6	0/100	1/100	1/100	0/100	93%*1 9%*2	87% 6%	7.0% 91%	13% 94%
実施例7	0/100	0/100	1/100	0/100	—	—	91%	—
比較例1	0/100	1/100	2/100	0/100	96.2%	98.6%	3.8%	1.4%

\*1)上段:P偏光、\*2)下段:S偏光

【0055】実施例3は45°入射で測定

実施例5はプリズム形状、45°入射で測定

実施例6はプリズム形状、45°入射で測定

実施例7は30°入射で測定

【0056】〔実施例2〕第1層をSiO<sub>2</sub>からSiO<sub>x</sub> (x:1.8~1.9、nd=1.506/λ<sub>0</sub>=530nm)、の層に変えた以外は、実施例1同様に5層多層膜を形成して評価した。結果を表1に記載する。

【0057】〔実施例3〕基材上に、以下の膜構成で13層多層膜を形成して赤色反射ダイクロミラーを製造し、実施例1同様の評価を行った。結果を表1に記載する。

(膜構成)

第1層: SiO<sub>2</sub>層 (nd=0.125λ<sub>0</sub>: λ<sub>0</sub>=725nm)

第2層: 混合物層 (nd=0.270λ<sub>0</sub>)

第3層: SiO<sub>2</sub>層 (nd=0.270λ<sub>0</sub>)

第4, 6, 8, 10, 12層: 混合物層 (nd=0.250λ<sub>0</sub>)

第5, 7, 9, 11層: SiO<sub>2</sub>層 (nd=0.250λ<sub>0</sub>)

第13層: SiO<sub>2</sub>層 (nd=0.125λ<sub>0</sub>)

(蒸着条件)

SiO<sub>2</sub>層:  $5 \times 10^{-5}$  torr、5 オングストローム/sec

混合物層:  $0.8 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-4}$  torr、0.5 ~ 2 オングストローム/sec

蒸着温度40℃

【0058】〔実施例4〕基材上に、以下の膜構成で17層多層膜を形成して近赤外線カットエッジフィルタを製造し、実施例1同様の評価を行った。結果を表1に記載する。(膜構成)

第1層: SiO<sub>2</sub>層 (nd=0.125λ<sub>0</sub>: λ<sub>0</sub>=770nm)

第2層: 混合物層 (nd=0.3375λ<sub>0</sub>)

第3, 5, 7, 9, 11, 13, 15層: SiO<sub>2</sub>層 (nd=0.250λ<sub>0</sub>)

第4, 6, 8, 10, 12, 14, 16層: 混合物層 (nd=0.250λ<sub>0</sub>)

第17層: SiO<sub>2</sub>層 (nd=0.125λ<sub>0</sub>)

(蒸着条件)

SiO<sub>2</sub>層:  $5 \times 10^{-5}$  torr、5 オングストローム/sec

混合物層:  $0.8 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-4}$  torr、0.5 ~ 2 オングストローム/sec

蒸着温度40℃

【0059】〔実施例5〕基材上に、以下の膜構成で17層多層膜を形成して、さらにその上に基材と同一形状の板を接着してプリズム型ビームスプリッターを製造し、実施例1同様の評価を行った。結果を表1に記載する。尚、密着強度は多層膜上に前記の板を接着する前の状態で評価し、光学性能は板を接着したプリズム形状の状態で評価した(以下、実施例において同じ)。

【0060】(膜構成)

第1層: SiO<sub>2</sub>層 (nd=0.220λ<sub>0</sub>: λ<sub>0</sub>=580nm)

第2層：混合物層 ( $n_d=0.220\lambda_o$ )  
 第3, 5層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.220\lambda_o : \lambda_o=580\text{nm}$ )  
 第7, 9層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.280\lambda_o$ )  
 第11, 13層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.340\lambda_o$ )  
 第15, 17層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.400\lambda_o$ )  
 第4層：混合物層 ( $n_d=0.220\lambda_o$ )  
 第6, 8層：混合物層 ( $n_d=0.280\lambda_o$ )  
 第10, 12層：混合物層 ( $n_d=0.340\lambda_o$ )  
 第14, 16層：混合物層 ( $n_d=0.400\lambda_o$ )

(蒸着条件)

$\text{SiO}_2$ 層： $5 \times 10^{-5} \text{ torr}$ 、5オングストローム/sec

混合物層： $0.8 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-4} \text{ torr}$ 、 $0.5 \sim 2 \text{ オングストローム/sec}$

蒸着温度 $40^\circ\text{C}$

【0061】〔実施例6〕基材上に、以下の膜構成で21層多層膜を形成して、さらにその上に基材と同一形状の板を接着して偏光ビームスプリッターを製造し、実施例1同様の評価を行った。結果を表1に記載する。

【0062】(膜構成)

第1層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.250\lambda_o : \lambda_o=410\text{nm}$ )

第2層：混合物層 ( $n_d=0.125\lambda_o$ )

第3, 5層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.325\lambda_o$ )

第7, 9層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.300\lambda_o$ )

第11, 13層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.275\lambda_o$ )

第15, 17層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.450\lambda_o$ )

第19, 21層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.250\lambda_o : \lambda_o=410\text{nm}$ )

第2, 4層：混合物層 ( $n_d=0.125\lambda_o$ )

第6, 8層：混合物層 ( $n_d=0.193\lambda_o$ )

第10, 12層：混合物層 ( $n_d=0.350\lambda_o$ )

第14, 16層：混合物層 ( $n_d=0.325\lambda_o$ )

第18, 20層：混合物層 ( $n_d=0.450\lambda_o$ )

(蒸着条件)

$\text{SiO}_2$ 層： $5 \times 10^{-5} \text{ torr}$ 、5オングストローム/sec

混合物層： $0.8 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-4} \text{ torr}$ 、 $0.5 \sim 2 \text{ オングストローム/sec}$

蒸着温度 $40^\circ\text{C}$

【0063】〔実施例7〕基材上に、以下の膜構成で10多層膜を形成して多層増反射ミラーを製造し、実施例1同様の評価を行った。結果を表1に記載する。

(膜構成)

第1層： $\text{SiO}$ 層 ( $n_d=0.250\lambda_o : \lambda_o=41$

0nm)

第2層： $\text{Al}$ 反射膜層 ( $n_d=0.200\lambda_o$ )

第3層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.250\lambda_o$ )

第4層：混合物層 ( $n_d=0.250\lambda_o$ )

第5, 7, 9, 11層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.250\lambda_o$ )

第6, 8, 10, 12層：混合物層 ( $n_d=0.250\lambda_o$ )

(蒸着条件)

10  $\text{SiO}_2$ 層： $5 \times 10^{-5} \text{ torr}$ 、5オングストローム/sec

混合物層： $0.8 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-4} \text{ torr}$ 、 $0.5 \sim 2 \text{ オングストローム/sec}$

$\text{Al}$ 反射膜層： $2 \times 10^{-5} \text{ Torr}$ 、 $10 \sim 20 \text{ オングストローム/sec}$

蒸着温度 $40^\circ\text{C}$

【0064】〔比較例1〕製造例1で得られた基材の表面に、真空蒸着法により4層多層構造の光反射防止層を形成した。膜構成は以下の通りである。

20 (膜構成)

第1層：混合物層 ( $n_d=0.125\lambda_o : \lambda_o=530\text{nm}$ )

第2層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.080\lambda_o$ )

第3層：混合物層 ( $n_d=0.230\lambda_o$ )

第4層： $\text{SiO}_2$ 層 ( $n_d=0.250\lambda_o$ )

(蒸着条件)

$\text{SiO}_2$ 層： $5 \times 10^{-5} \text{ torr}$ 、5オングストローム/sec

30 混合物層： $0.8 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-4} \text{ torr}$ 、 $0.5 \sim 2 \text{ オングストローム/sec}$

蒸着温度 $40^\circ\text{C}$

【0065】以上、本発明の実施例においては、 $\text{SiO}_2$ を第一層としても、タンタル混合物層を第一層とする従来のものと同等若しくはそれ以上に膜の初期密着性及び耐久性に優れていることが確認できる。光学性能に関しては、例えば反射防止膜の場合は、本発明実施例1の場合は反射率が低く反射防止効果に優れるが、比較例1の従来のものは実施例1と比較しても反射率が大きく、反射防止効果に劣っていることが確認でき、他の実施例においても、それぞれ目的とする光学性能に優れることが確認できる。

【0066】

【発明の効果】本発明によれば、多層薄膜の密着強度、耐久性、及び光学性能に優れた積層体を提供することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	ターム (参考)
G 0 2 B 5/30		G 0 2 B 1/10	A

F ターム (参考) 2H042 DA08 DA11 DA15 DB01 DC02  
 DC12  
 2H048 GA04 GA05 GA11 GA14 GA19  
 GA36 GA43  
 2H049 BA05 BA43 BB62 BC10  
 2K009 AA08 AA09 BB12 CC03 DD03  
 4F100 AA17C AA20B AB01D AK02A  
 BA03 BA04 BA07 BA10A  
 BA10C EH36 EH66 GB41  
 GB90 JK06 JL00 JN00 JN06D  
 YY00C

**RESULT LIST**

2 results found in the Worldwide database for:

**JP2002321302** (priority or application number or publication number)

(Results are sorted by date of upload in database)

**1 TEMPERATURE SENSOR DEVICE AND TURNING DEVICE WITH THE SAME**

Inventor: MORITA KOICHI

Applicant: NSK LTD

EC:

IPC: *F16C19/52; G01K7/00; F16C19/00* (+3)Publication info: **JP2004156957** - 2004-06-03**2 POLYMER RESIN LAMINATED MATERIAL CONTAINING ALICYCLIC STRUCTURE**

Inventor: HATAKE KOTARO

Applicant: NIPPON ZEON CO

EC:

IPC: *B32B9/00; B32B27/00; G02B1/11* (+15)Publication info: **JP2002321302** - 2002-11-05

---

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide